

Inhalt

		Seite
<i>A. Grassmann</i>	Stand und Trends der Lithographie	1
<i>M. Zander und U. Mescheder</i>	Maskenmetrologie: Anforderungen und Trends	7
<i>R. Schießl-Hoyler</i>	Abbildung von Reticle-Defekten auf Wafer	41
<i>Ch. Nölscher</i>	Phasenmaskenkonzepte und -technologien	61
<i>R. Rehländer, M. Franosch, Ch. Nölscher und M. Steinhauser</i>	Experimentelle Herstellung und Charakterisierung von selbstjustierten Rimtyte-Phasenmasken	81
<i>P. D. Buck und M. L. Rieger</i>	Phase Shifting Masks by Scanned Laser Lithography	95
<i>H. Wolf und E. Jahn</i>	Ergebnisse der Maskenherstellung mit dem Elektronenstrahlschreiber ZBA 21	107
<i>R. Springer, F. Heinlein und M. Irmscher</i>	Maskenherstellung und Wafer-Direktschreiben mit dem Elektronenstrahlschreiber HL-700 D(M)	121